カ　975ナノメートル超1,150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　単一横モードで発振するものであって、定格出力が500ワットを超えるもの
(ｲ)　多重横モードで発振するものであって、次のａ又はｂに該当するもの（産業用レーザー発振器であって、定格出力が２キロワット超６キロワット以下のもののうち、総重量が1,200キログラムを超えるもの又はｃに該当するものを除く。）
ａ　ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、定格出力が500ワットを超えるもの
ｂ　定格出力が２キロワットを超えるもの
ｃ　産業用レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(a)　定格出力が500ワット超１キロワット以下のものであって、次のｉ及びiiに該当するもの
ｉ　ビームパラメータ積が0.7ミリメートル・ミリラジアン超のもの
ii　輝度が1,024ワット毎平方ミリメートル毎平方ミリラジアン以下のもの
(b)　定格出力が1.0キロワット超1.6キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が1.25ミリメートル・ミリラジアン超のもの
(c)　定格出力が1.6キロワット超2.5キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が1.7ミリメートル・ミリラジアン超のもの
(d)　定格出力が2.5キロワット超3.3キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が2.5ミリメートル・ミリラジアン超のもの
(e)　定格出力が3.3キロワット超4.0キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が3.5ミリメートル・ミリラジアン超のもの
(f)　定格出力が4.0キロワット超5.0キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が5.0ミリメートル・ミリラジアン超のもの
(g)　定格出力が5.0キロワット超6.0キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が7.2ミリメートル・ミリラジアンを超えるもの
(h)　定格出力が6.0キロワット超8.0キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が12.0ミリメートル・ミリラジアンを超えるもの
(i)　定格出力が8.0キロワット超10.0キロワット以下のものであって、ビームパラメータ積が24.0ミリメートル・ミリラジアンを超えるもの
⑵　波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
ア　600ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当するもの（(ｳ)に該当するものを除く。）
(ｱ)　１パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が１ワットを超えるもの
(ｲ)　平均出力又は持続波の定格出力が１ワットを超えるもの
(ｳ)　色素レーザー発振器又は液体レーザー発振器のうち多重横モードで発振するように設計したもので、かつ、150ナノメートル以上600ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のａ及びｂに該当するもの
ａ　１パルス当たり1.5ジュール未満のパルスを発振するもの又はピーク出力が20ワット未満のもの
ｂ　平均出力又は持続波の定格出力が20ワット未満のもの
イ　600ナノメートル以上1,400ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　１パルス当たり１ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が20ワットを超えるもの
(ｲ)　平均出力又は持続波の定格出力が20ワットを超えるもの
ウ　1,400ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　１パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が１ワットを超えるもの
(ｲ)　平均出力又は持続波の定格出力が１ワットを超えるもの
⑶　レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
ア　単一横モードで発振する単一の半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　1,510ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が1.5ワットを超えるもの
(ｲ)　1,510ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が500ミリワットを超えるもの
イ　多重横モードで発振する単一の半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が15ワットを超えるもの
(ｲ)　1,400ナノメートル以上1,900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が2.5ワットを超えるもの
(ｳ)　1,900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が１ワットを超えるもの
ウ　単一の半導体レーザーバーであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が100ワットを超えるもの
(ｲ)　1,400ナノメートル以上1,900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が25ワットを超えるもの
(ｳ)　1,900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が10ワットを超えるもの
エ　半導体レーザースタックアレーであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
ａ　総平均出力又は持続波の総定格出力が３キロワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が500ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ｂ　総平均出力又は持続波の総定格出力が３キロワット以上５キロワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が350ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ｃ　総平均出力又は持続波の総定格出力が５キロワットを超えるもの
ｄ　ピークパルス出力密度が2,500ワット毎平方センチメートルを超えるもの（エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。）
ｅ　空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が150ワットを超えるもの
(ｲ)　1,400ナノメートル以上1,900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
ａ　総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が150ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ｂ　総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット以上500ワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が50ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ｃ　総平均出力又は持続波の総定格出力が500ワットを超えるもの